

NAR Labs 國家實驗研究院 國家奈米元件實驗室		文件編號 DOCUMENT NO.	S3-NL05
		總頁數 TOTAL PAGE	共 2 頁
文件名稱 TITLE	薄膜附著力測試系統		

機台名稱： 薄膜附著力測試系統

機台編號： CF-M20


制訂部門： 微影光罩組

制訂日期： 2006/08/15

文件制修訂記錄

NO	發行日期	修訂申請書編號	制修訂內容	修訂頁次	版本
01	2006/09/01	-----	制定初版	-----	01
02	2007/09/20	96-DC10	文件名稱異動	全部	1.2
03	2008/10/29	97-DC30	文件內文修訂	P.2	1.3
04	2009/03/01	98-DC01	制訂部門名稱異動	P.0	1.4
05	2013/07/01		制訂部門名稱異動	P.1	
06					
07					
08					

核 准	審 查	制 訂

		文件編號 DOCUMENT NO.	S3-NL05
		總頁數 TOTAL PAGE	共 2 頁
文件名稱 TITLE	薄膜附著力測試系統		

一、目的：

量測薄膜的附著力

二、範圍：

量測沉積在 Si 晶片上的薄膜的附著力。

三、權責：

1. 組織權責：工程師負責制定及修改規範。
2. 執行人員資格：經過薄膜附著力測試系統考核通過之人員。

四、名詞定義：

無

五、相關文件：

Adhesion tester manual.

六、標準作業程序：

1. 製備量測試片。
 - (1) 從冰箱中拿出欲量測 Al studs 的退冰 10 mins，使用 stud mounting clips 固定釘子與 sample 的位置。
 - (2) 將 clips、sample、studs 放置在加熱器上加熱 1.5 hrs，加熱溫度為 150°C。
2. 將 sample、studs 置於量測平台的三腳爪中並固定之。
3. MES 登入開機，進入 win95 畫面選擇 Zeta 500 應用程式進入使用畫面。
4. Zeta 500 應用程式的使用方式：


```
press any key to continue -->select unit of measurement {公制、英制...}-->test menu-->breaking point test-->coating test-->filename/lot number/sample description-->pull rate <slow>-->F4-->F5/ ESC
```

 - ◆當 Al stud 與 sample 分離時即為實驗值
5. 紀錄機台狀況。
6. 使用者登出並刷卡關機。

七、應用表單及附件：

1. 設備考核表 S4-NL01A
2. 設備點檢表 S4-NL01B
3. 設備使用記錄表 S4-NL01C

NAR Labs 國家實驗研究院 國家奈米元件實驗室		文件編號 DOCUMENT NO.	S3-NL05
		總頁數 TOTAL PAGE	共 2 頁
文件名稱 TITLE	薄膜附著力測試系統		

- 4. 異常及矯正預防處理單 S4-NL02A
- 5. 儀器設備管理卡 S4-NL04B